

# スプレーコーター

USC-2000ST Spray Photoresist Coater

## 特長 Features

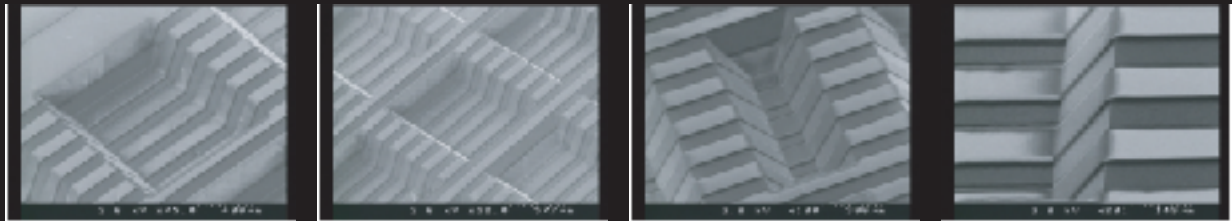
- 200 $\mu$ m以上の段差基板に、膜切れなくコーティング可能  
Continuous coating on to the step with over 200 $\mu$ m height.
- ピンホールのないコーティング  
Optimum coating without pin-holes.
- タッチパネル上でレシピ操作可能  
Touch-panel display makes the recipe operation easy.
- コンパクト設計 (W800 x D1100 x H1700mm)  
Compact design.
- 4~6 inchウェーハ対応  
Available for 4-6 inch Si wafer.



USC-2000ST

本製品は、東北大学工学部 羽根・佐々木研究室との共同開発品です  
This product is co-developed with Dr. Hane and Dr. Sasaki's laboratory of Tohoku University.

## 段差基板へのコーティング例



## 主な仕様 Specifications

### MODEL USC-2000ST

Work	φ 4 inch Si wafer (6-8 inch optional)
Photoresist Supplying Method	2 liquid mixture spray method
Control Method	Mass flow method
Workstage	XYZ stage with temperature control (25-80°C)
Utilities	Power supply : AC200V ±20V Vacuum : -80kPa N2 : 0.5mPa 50 l/min Exhaust : 2-3m <sup>3</sup> /min

### OPTIONS

N2 generator
6-8 inch Si wafers
Cassette to cassette transfer
Blower unit